

ナノテクノロジープラットフォーム事業(微細加工)共用機器使用料設定料金

I 1時間あたりの使用料

単位:円、消費税込み

| 番号 | 共用機器種別 | 依頼測定時 | | | 直接測定時 | | |
|----|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 学内者 | 学外者 | | 学内者 | 学外者 | |
| | | | 非営利法人 | 営利法人 | | 非営利法人 | 営利法人 |
| 1 | マスクアライナ キャノン社製 PLA-501(S) | 400 | 400 | 700 | 400 | 400 | 700 |
| 5 | イオン注入装置 日新電機社製 NH-20SR-WMH | 1,300 | 1,500 | 2,000 | 1,300 | 1,500 | 2,000 |
| 7 | 走査型電子顕微鏡 日本電子社製 JSM-6301F | 500 | 600 | 800 | 500 | 600 | 800 |
| 8 | 電気炉 光洋リントハーク社製 MODEL272-2 | 1,100 | 1,300 | 1,600 | 1,100 | 1,300 | 1,600 |
| 9 | 急速加熱理装置 AG Associates社製 Heatpulse610 | 1,000 | 1,100 | 1,300 | 1,000 | 1,100 | 1,300 |
| 11 | 薄膜X線回折装置 RIGAKU社製 ATX-G | 800 | 900 | 1,200 | 800 | 900 | 1,200 |
| 12 | 原子間力顕微鏡 Bruker社製 AXS Dimension3100 | 500 | 600 | 800 | 500 | 600 | 800 |
| 13 | 8元マグネトロンスパッタ装置 | 800 | 900 | 1,300 | 800 | 900 | 1,300 |
| 14 | 8元MBE装置 | 1,300 | 1,500 | 1,900 | 1,300 | 1,500 | 1,900 |
| 15 | ECR-SIMSエッチング装置 | 500 | 600 | 900 | 500 | 600 | 900 |
| 16 | 3元マグネトロンスパッタ装置 島津製作所製 HSR-522 | 900 | 1,000 | 1,300 | 900 | 1,000 | 1,300 |
| 17 | 露光プロセス装置一式 ユニオン光学社製 PEM800 | 300 | 400 | 600 | 300 | 400 | 600 |
| 22 | レーザー描画装置 Heidelberg Instruments社製 DWL66FS ()内は1回あたりの料金 ※8時間以上の長時間描画での試料作製を行う場合 | 600 (6,800) | 700 (7,800) | 900 (9,800) | 600 (6,800) | 700 (7,800) | 900 (9,800) |
| 23 | フォトリソグラフィ装置 ウシオ電機社製 マルチライトML251A/B、共和理研社製 スピナー-K-359SD-1 | 600 | 700 | 1,000 | 600 | 700 | 1,000 |
| 24 | 分子線エビタキシー装置 エイコーエンジニアリング社製 ()内は1日あたりの料金 | 1,900 (15,600) | 2,200 (17,900) | 3,100 (24,600) | 1,900 (15,600) | 2,200 (17,900) | 3,100 (24,600) |

ナノテクノロジープラットフォーム事業(微細加工)共用機器使用料設定料金

I 1時間あたりの使用料

単位:円、消費税込み

| 番号 | 共用機器種別 | 依頼測定時 | | | 直接測定時 | | |
|----|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | 学内者 | 学外者 | | 学内者 | 学外者 | |
| | | | 非営利法人 | 営利法人 | | 非営利法人 | 営利法人 |
| 25 | 電子ビーム蒸着装置 アルバック社製 EBX-10D | 600 | 700 | 900 | 600 | 700 | 900 |
| 26 | スパッタ絶縁膜作製装置 MESアフティ社製 AFTEX-3420 | 800 | 900 | 1,200 | 800 | 900 | 1,200 |
| 27 | ICPエッチング装置 アルバック社製 CE-300I | 900 | 1,100 | 1,400 | 900 | 1,100 | 1,400 |
| 28 | RIEエッチング装置 サムコ社製 RIE-10NR | 600 | 700 | 900 | 600 | 700 | 900 |
| 29 | 走査型電子顕微鏡 日立ハイテクノロジーズ社製 S5200 | 900 | 1,000 | 1,300 | 900 | 1,000 | 1,300 |
| 30 | 段差計 アルバック社製 Dektak150 | 300 | 300 | 400 | 300 | 300 | 400 |
| 31 | 超高密度大気圧プラズマ装置 富士機械製造(株)社製 | 300 | 400 | 500 | 300 | 400 | 500 |
| 32 | 超高密度液中プラズマ装置 NUシステム社製 | 400 | 400 | 500 | 400 | 400 | 500 |
| 33 | 大気圧IAMS(イオン付着質量分析器) キャンシアネルバ社製 | 700 | 800 | 900 | 700 | 800 | 900 |
| 34 | 真空紫外吸収分光計(原子ラジカルモニター) NUシステム社製 | 1,000 | 1,100 | 1,300 | 1,000 | 1,100 | 1,300 |
| 35 | In-situ 電子スピン共鳴(ESR) Bruker社製 EMX Premium X | 1,100 | 1,300 | 1,500 | 1,100 | 1,300 | 1,500 |
| 36 | 二周波励起プラズマエッチング装置 | 900 | 1,100 | 1,400 | 900 | 1,100 | 1,400 |
| 37 | 60MHz励起プラズマCVD装置 東京エレクトロン社製 | 1,300 | 1,500 | 1,800 | 1,300 | 1,500 | 1,800 |
| 38 | ラジカル計測付多目的プラズマプロセス装置 | 1,200 | 1,400 | 1,800 | 1,200 | 1,400 | 1,800 |
| 39 | レーザー描画装置 Heidelberg社製 DWL66 uTAS | 400 | 500 | 700 | 400 | 500 | 700 |

ナノテクノロジープラットフォーム事業(微細加工)共用機器使用料設定料金

I 1時間あたりの使用料

単位:円、消費税込み

| 番号 | 共用機器種別 | 依頼測定時 | | | 直接測定時 | | |
|-----------|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | 学内者 | 学外者 | | 学内者 | 学外者 | |
| | | | 非営利法人 | 営利法人 | | 非営利法人 | 営利法人 |
| 40 (1) | 磁気特性評価システム (1)交番磁界勾配型磁力計 | 600 | 700 | 900 | 600 | 700 | 900 |
| 40 (2) | 磁気特性評価システム (2)振動試料型磁力計 | 500 | 500 | 700 | 500 | 500 | 700 |
| 40 (3) | 磁気特性評価システム (3)トルク磁力計 | 500 | 600 | 700 | 500 | 600 | 700 |
| 40 (4) | 磁気特性評価システム (4)磁気光学スペクトロメータ | 600 | 700 | 900 | 600 | 700 | 900 |
| 41 (1) | マスクアライナー式 (1)Suss MicroTec AG製 MA-6 | 400 | 400 | 700 | 400 | 400 | 700 |
| 41 (2) | マスクアライナー式 (2)Suss MicroTec AG製 MJB-3 | 200 | 300 | 400 | 200 | 300 | 400 |
| 41 (3) | マスクアライナー式 (3)ナノテック製 LA410 | 200 | 200 | 300 | 200 | 200 | 300 |
| 42 | スプレーコーター一式 サンメイ製 DC110 | 300 | 400 | 500 | 300 | 400 | 500 |
| 43 | レーザ描画装置一式 Heidelberg製 mPG101-UV | 900 | 1,000 | 1,300 | 900 | 1,000 | 1,300 |
| 44 | スパッタリング装置一式 キャノンアネルバ製 E-200S | 1,600 | 1,900 | 2,200 | 1,600 | 1,900 | 2,200 |
| 45 (1) | 3次元レーザ・リソグラフィシステム一式 (1)Nanoscribe製 フォトニック・プロフェッショナル | 1,000 | 1,100 | 1,400 | 1,000 | 1,100 | 1,400 |
| 45 (2) | 3次元レーザ・リソグラフィシステム一式 (2)KISCO製 SCLEAD3CD2000 | 100 | 100 | 300 | 100 | 100 | 300 |
| 46 | 光三次元造形装置一式 Object製 EDEN250 | 600 | 700 | 900 | 600 | 700 | 900 |
| 47 | ナノインプリント装置一式 SCIVAX製 X-300 BVU-ND | 200 | 200 | 400 | 200 | 200 | 400 |
| 48 | パリレンコーティング装置一式 KISCO製 DACS-LAB | 100 | 100 | 200 | 100 | 100 | 200 |
| 49 | 小型微細形状測定機一式 小坂研究所製 ET200 | 200 | 200 | 300 | 200 | 200 | 300 |

ナノテクノロジープラットフォーム事業(微細加工)共用機器使用料設定料金

I 1時間あたりの使用料

単位:円、消費税込み

| 番号 | 共用機器種別 | 依頼測定時 | | | 直接測定時 | | |
|----|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | 学内者 | 学外者 | | 学内者 | 学外者 | |
| | | | 非営利法人 | 営利法人 | | 非営利法人 | 営利法人 |
| 50 | 蛍光パイクイメーシング装置一式 共焦点レーザ顕微鏡システム ニコン製 A1Rsi-N | 400 | 500 | 700 | 400 | 500 | 700 |
| 51 | ICPエッチング装置一式 サムコ製 RIE-800 | 3,500 | 4,100 | 4,800 | 3,500 | 4,100 | 4,800 |
| 52 | ECRスパッタリング装置一式 エリオニクス製 EIS-230S | 300 | 300 | 500 | 300 | 300 | 500 |
| 54 | 高精度電子線描画装置一式 日本電子(株)製 SPG-724 | 800 | 900 | 1,200 | 800 | 900 | 1,200 |
| 55 | SEM用断面試料作製装置 JEOL製 SM-09010 | 100 | 200 | 200 | 100 | 200 | 200 |
| 56 | デジタルマイクロスコープ一式 KEYENCE製 VK-9700 | 400 | 500 | 600 | 400 | 500 | 600 |
| 57 | 電子線露光装置 日本電子社製 JBX6300FS | 2,200 | 2,600 | 3,400 | 2,200 | 2,600 | 3,400 |
| 58 | フェムト秒レーザー加工分析システム UFL-Hybrid | 1,300 | 1,500 | 2,100 | 1,300 | 1,500 | 2,100 |
| 59 | X線光電子分光装置 KRATOS社製 AXIS-HSI | 2,000 | 2,300 | 2,800 | 2,000 | 2,300 | 2,800 |
| 60 | フーリエ変換赤外分光分析装置 日本分光社製 FT/IR-615V型 | 500 | 600 | 800 | 500 | 600 | 800 |
| 61 | ICPエッチング装置一式 エリオニクス製 EIS-700 | 1,500 | 1,700 | 2,100 | 1,500 | 1,700 | 2,100 |
| 62 | プラズマCVD装置 サムコ製 PD-240 | 800 | 900 | 1,200 | 800 | 900 | 1,200 |
| 63 | ダイシングソー装置 NUシステム製 NU-CCP/ALD | 800 | 1,000 | 1,200 | 800 | 1,000 | 1,200 |
| 64 | リアクティブイオンエッチング装置 サムコ製 RIE-10N | 1,100 | 1,300 | 1,600 | 1,100 | 1,300 | 1,600 |
| 65 | プラズマ支援原子層堆積装置 NUシステム製 NU-CCP/ALD | 1,700 | 1,900 | 2,200 | 1,700 | 1,900 | 2,200 |
| 66 | 高温プロセス用誘導結合型プラズマエッチング装置 NUシステム製 NU-RC/CI-Etch | 1,900 | 2,200 | 2,600 | 1,900 | 2,200 | 2,600 |

ナノテクノロジープラットフォーム事業(微細加工)共用機器使用料設定料金

I 1時間あたりの使用料

単位:円、消費税込み

| 番号 | 共用機器種別 | 依頼測定時 | | | 直接測定時 | | |
|----|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | 学内者 | 学外者 | | 学内者 | 学外者 | |
| | | | 非営利法人 | 営利法人 | | 非営利法人 | 営利法人 |
| 67 | 表面解析プラズマビーム装置 NUシステム製 LIA-Plasma Beam/CF&Cl System | 3,600 | 4,200 | 5,300 | 3,600 | 4,200 | 5,300 |
| 68 | in-situプラズマ照射表面分析装置 0 | 2,300 | 2,700 | 3,300 | 2,300 | 2,700 | 3,300 |
| 69 | 走査型イオン顕微鏡 0 | 800 | 1,000 | 1,300 | 800 | 1,000 | 1,300 |
| 70 | 原子間力顕微鏡 日本Veeco製 NanoMan VS-1N | 200 | 200 | 300 | 200 | 200 | 300 |
| 71 | デジタルマイクロスコープ式 KEYENCE製 VK-9510 | 500 | 600 | 700 | 500 | 600 | 700 |
| 72 | 透過型電子顕微鏡 JEM2100 | 1,000 | 1,100 | 1,500 | 1,000 | 1,100 | 1,500 |
| 73 | Deep Si Etcher 住友精密工業製 Multiplex-ASE | 2,900 | 3,300 | 4,000 | 2,900 | 3,300 | 4,000 |
| 74 | 走査型電子顕微鏡 日立ハイテクフィールドディング社製S4300 | 800 | 1,000 | 1,200 | 800 | 1,000 | 1,200 |
| 75 | X線光電子分光装置 VG社製 ESCALAB250 | 1,600 | 1,900 | 2,300 | 1,600 | 1,900 | 2,300 |

★研究成果非公開使用料は、共用機器1時間あたりのオプション料金であり、別途加算する。

☆上記共用機器使用料は、文部科学省「ナノテクノロジープラットフォーム事業(微細加工)」の採択により軽減されております。

平成34年3月31日の事業終了後は、通常の料金設定となります。

II 算出内訳 別紙1のとおり

III 項目別算出基礎 別紙2のとおり

IV 解析手数料(1時間当たり)

単位:円、消費税込み

| 解析手数料 | 学内者 | 学外者 | |
|-------|-----|-------|-------|
| | | 非営利法人 | 営利法人 |
| | | | 5,800 |

V 算出基礎 別紙3のとおり